# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61-007822

(43) Date of publication of application: 14.01.1986

(51) Int. CI.

(21) Application number: 59-127407 (71) Applicant: CANON INC

(22) Date of filing:

22. 06. 1984

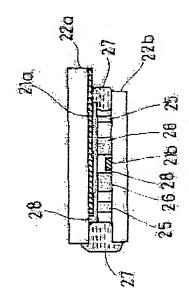
(72) Inventor: OKADA SHINJIRO

# (54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT

# (57) Abstract:

PURPOSE: To form stably the spacing between electrode substrates as small as 1W2µm by forming a spacer part to the central part of the electrode substrates then printing an adhesive agent thereto and adhering and fixing a pair of the electrode substrates together with the adhesive agent at the circumferential

CONSTITUTION: The spacer member 25 consisting of a polyimide resin is formed by using a lithographic film forming technique on either one of a pair of the transparent substrates 22a, 22b. Adhesive agent stripes are printed and formed by screen or offset printing, etc. on the member 25. A pair of the substrates 22a, 22b are adhered and fixed together with the adhesive agent 27 at the circumferential edge. The film forming technique controllable in the thickness of an Å unit is utilized in the



stage of forming the member 25 and therefore the uniform and stable intersubstrate spacing is formed even if said spacing is as small as 1W2µm.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's

⑪特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭61-7822

@Int\_Cl\_4

識別記号

广内整理番号

每公開 昭和61年(1986)1月14日

G 02 F 1/133

1 2 3 8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**公発明の名称** 液晶素子の製造方法

**到特 願 昭59-127407** 

❷出 願 昭59(1984)6月22日

72発明者 岡

伸二郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

**码代 理 人** 弁理士 猿渡 章雄 :

外1名

明 細 標

1. 桑明の名称

液晶紫子の製造方法

## 2. 特許請求の範囲

2.前記スペーサ部材を、一様な成践ならびにその部分的除去工程を含むリングラフィー技術により形成する特許請求の範囲第1項に記載の液晶業子の製造方法。

3. 基板中央部に形成する接着剤およびスペーサ部材がいずれもポリイミド系関脂からなる特許請求の範囲第1項または第2項に記載の液晶素子の型造方法。

3.発明の詳細な説明

#### 技能分野

木桑明は、液晶要示整型におけるセルの要法に関するもので、特に1~2μmというように数小な関係を必要とする液晶要示用セルの製法に関するものである。

### 背景技套

後、上記のようなギャップ制御材を均一に散布して、返明基板間の開隔を保持しつつ接着固定を行なう方法が行なわれていた。

しかしながら、上記のような方法では、 茲板間隔に多少のバランキがでることに避けられず、 特に 茲板間隔が 1 ~ 2 μ m 程度に降くなると、生ずる 芸板間隔のバラッキが表示特性に与える悪影響が無視できなくなる。

#### 発明の目的

本発明の目的は、上述の事情に鑑み、 基板間隔が 1 ~ 2 μ 皿程度と 微小な場合であっても、 均一・で安定な蒸板間隔を有する液晶度示用セルを製造する方法を提供することにある。

#### 発明の概要

本発明の液晶表示用セルは、上述の目的を達成するために開発されたものであり、より詳しくは、それぞれ一面に電極を形成した一対の電極基板を、それぞれの電極形成面を内側にして対向配置し、周貸部を接着剤により接着固定して液晶器示用セルを形成するに戻して、少なくとも一方の

る一対の透明基板22a、22bを用意し、まず この蓋板の少なくとも一方の上にスペーサ部材と 5 を形成する。このスペーサ部材形成は、好まし くは一様な成膜ならびにその部分的除去工程を含 むリソグラフィー技術により形成される。スペー サ部材材料としては樹脂材料が好ましく用いら れ、なかでも厚膜形成ができること、液晶の水平 配向性がある等の理由によりポリイミドが好まし く用いられる。リングラフィー技術により例えば 厚.さ.が 1 ~ 3 μm、 幅 5 ~ 1 0 0 μmのストライ プ状スペーサ部材25を、0、1~2mmのピッ チで形成した後、スペーサ部材12の間に供えば 0.1~2mm程度の適宜の間隔で接着剤26を 印刷により形成する。この接着剤の好ましい一個 は未便化のポリイミド樹脂であり、これをスク リーンもしくはオフセット印刷等の方法により印 **関して例えば厚さ、1、0~3、0μm、m0、1** ~ 0 . 5 μ 皿 程度の接着剤ストライプ 1 3 を形成 する:また同様な材質(この場合は、上記の接着・ 剤と同時に生布できる) あるいはエポキシ系 樹脂

語板の中央部において、スペーサ部材を形成した 使、接着剤を印刷し、周縁部に設けた接着剤とと もに一対の電極路板を接着固定することを特徴と するものである。

#### 实施例

第2回は、本発明方法に従う液晶表示セル製造 過程を説明するための斜視図である。

す な わ ち 、 そ れ ぞ れ I T 〇 ( イ ン ジ ウ ム ー す ず 複 合 酸 化 物 ) 等 か ら な る 透 明 電 複 を 設 け 且 つ 必 要 に 応 じ て 液 晶 配 向 膜 を 形 成 し た ガ ラ ス 板 等 か ら な

等からなる異なる材質の接着剤 2 7 を周録部に墜布し、他方の基板と組合せて接着固定する。

第3 図は、かくして得られる液晶セルの一例の 厚さ方向断面図であり、この例では、対向基板 2 2 a上には、電程膜 2 1 aを覆って液晶配向用 にポリイミド樹脂膜 2 8 のみが形成されている。

上記例示の液晶要示セルの具体的な製造例を説明する。

#### 伤 1

まず透明で核21bを設けたガラス基板上に、アー(2-アミノエチル)アミノブロビルトリメトキシシランのロブタノールの、3wl%溶液をスピンナーを用い2000rpm、40秒の条件で鑑布し、150℃に30分間保持してで化で、サーンに30分間保持してである。
の0rpm、1分間の条件でスピンコートリインののです。150℃に続成して厚さ2μmのポリイミド膜を形成した。次いで、ポジレジストを用いてパターン化し、更にこドラジンNaOH 混合液によ

**狩開昭61-7822(3)** 

. り、上記ポリイミドを30°Cに加熱したビロリドン: NaOH3%溶液= 4:3 混合液に5~15分間機体してポリイミドをエッチングした後、レジストを網離してストライブ状のスペーサ25を

その移再び、上記のように、アー(2-アミノエチル)アミノブロビルトリノトキシシランの n ブタノール 0 ・3 w t %溶液を 基 板 全面に 鑒 布 し 使化させた 後に、上記ポリイミド 前駆体 S P-510をスクリーン P 刷もしくは、オフセット P D 刷 生により、ストライブ 2 6 および 2 7 のように D

他方、対向基板22aは、ITO電ぎ21a上に厚さ400~500Aのポリイミド限28を形成し、ラビング処理したものであって、これを上記のように接着剤を印刷した基板22bと位置合せした後、接着を行ない、40kg/cm²程度の圧力でプレスしつつ、240℃で3時間焼成した。

これにより、2mmの均一な基板間隔を有する

#### 4. 図面の簡単な説明

野 1 区は炭来の在品設示セルの厚さ方向断面図、 第 2 区は本発明方法に従う在品装示セル製造品程を説明するための新視図、 第 3 図は得られる 在品表示セルの一例の厚さ方向断面図である。

1 1 a . 1 1 b . 2 i a . 2 l b · · 适明電標

2 2 a 、 2 2 b · · · 透明遊椒

25・・・スペーサ部材

26 · · 中央部接着前

13、27・・・周録部接着剤

<u>代表図面</u>: 52 2 2

出版 人代理人 重覆 章 超 显然 。

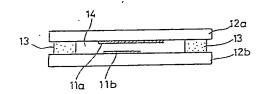
郊 3 欧に示すようなセルが得られた。 <u>低 2</u>

上 紀 例 1 の 方 法 に お い て は 、 上 下 ガ ラ ス 基 板 を 、 ボ リ イ ミ ド 接 着 剤 2 6 お よ び 2 7 の み に よ っ て 接 着 し て い る 。 こ の た め 、 ブ レ ス の 膜 の ガ ラ ス 基 板 に 俄 ら く 応 力 や 歪 の 解 稍 に よ っ て 、 到 難 が 生 じ 易 い 欠 点 が ある。

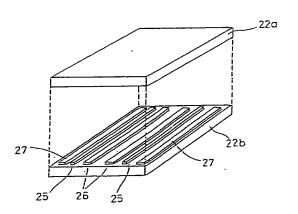
#### 発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、茲板間 既が1~2μm程度というように微小である被晶 要示用セルを形成するに険して、茲板中央部にス

## 第 1 図



## 第 2 図



第3図

